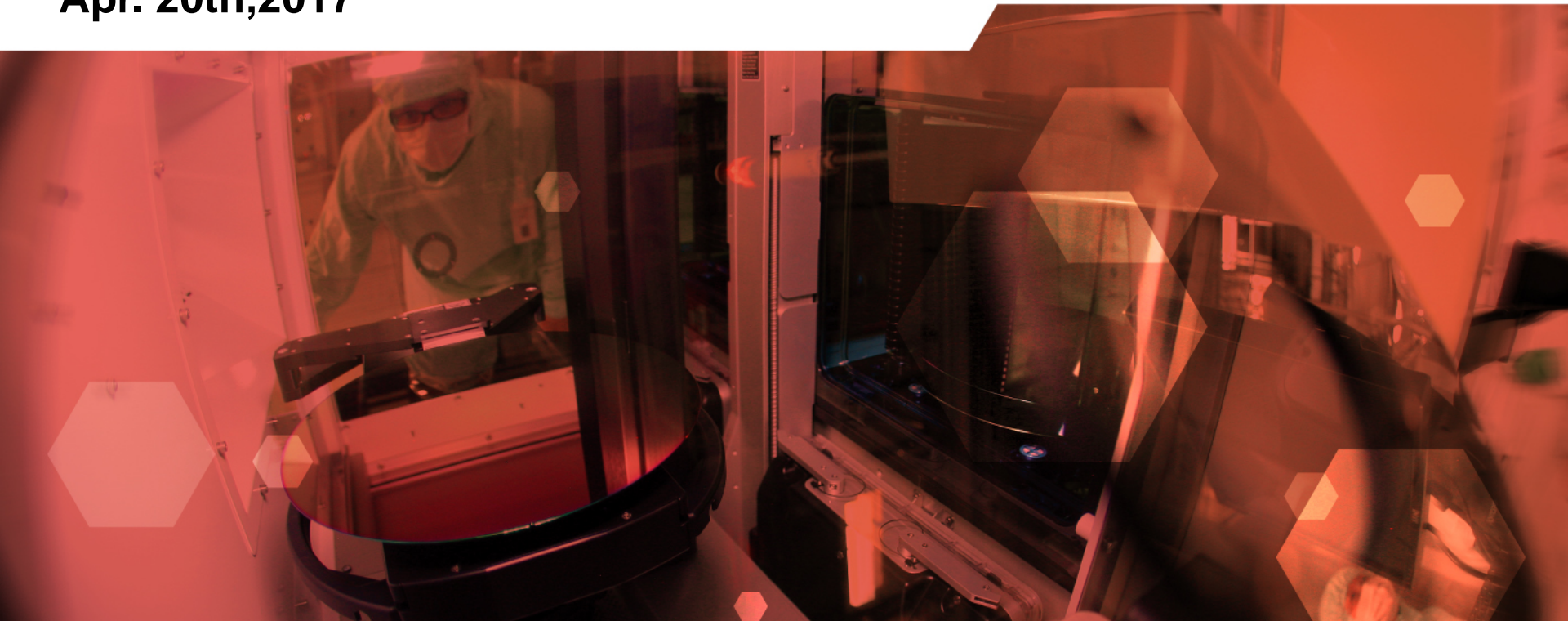


# SEMI China HB-LED Std. Technical Committee **Pattern Sapphire Substrate** Task Force

Jianzhe liu

Apr. 20th, 2017



# Leaders of Pattern Sapphire Substrate Task Force

No.	Name	Company	Industry Chain
1	Jianzhe Liu	ECBO	Sapphire Manufacturing(PSS)

# Members of Pattern Sapphire Substrate Task Force

No.	Name	Company	Industry Chain
1	Xiaoyan Sheng	ECBO	Sapphire Manufacturing
2	Junwei Chu	ECBO	Sapphire Manufacturing
3	Hongbo Zuo	AURORA	Sapphire Manufacturing
4	Jiangbo Wang	HC semitek	Epitaxial & Chip
5	Liangwen Wu		Epitaxial & Chip
6	Mingsheng Chen	ETI	Epitaxial & Chip
7	Yang Gan	HIT	Processing Materials
8	Chongshi Niu	Monocrystal	Sapphire Manufacturing
9	Guoping Li	KRDQ	
10	Mingde Wei	GAPSS	Epitaxial & Chip
11	Fanghu Si	Jing'an	Sapphire Manufacturing
12	Mingxin Chen	Jing'an	Sapphire Manufacturing
13	Airs Ma	AK Optics	Processing Equipment

## Documents in Work

### 1) NEW SNARF( Jing'an) Specification for Dry etching Patterned Sapphire Substrate (DPSS)

»Jing'an proposed a new SNARF for Specification for Dry etching Patterned Sapphire Substrate (DPSS)

晶安提出了一个干法刻蚀图形化蓝宝石衬底标准的新提案。

# Progress on the Documents

## NEW SNARF ( Jing'an) Specification for Dry etching Patterned Sapphire Substrate (DPSS) Meeting Minutes

华灿光电王江波总：

- 规格尺寸和量测方法的标准是不一样的；
- 该新提案的范围比较大；
- PSS测试方法的标准，如何测量规格，专门做测试方法的标准；
- 背景上：语句斟酌，描述需要再修改一下；
- 该标准是否只是针对某一种类型的PSS？
- 中心值定义成某个常数，只要定义误差范围。华灿有供企业内部用的标准。
- 标准涉及内容范围：边缘去除的范围，PIN压面积规范是PSS Table里缺失的，还有一种类型“图形的定义”也是PSS Table里缺失的。
- 误差单位要尽量准确；
- 中心值 1.6-1.8，误差范围在0.1；
- 没有必要限制尺寸，按照大小的总面积去写的；
- 如果是纳米，很难用颗粒去做定义；
- 图形缺失：2寸和4寸，华灿内部的标准上，也是有差异的；

# Progress on the Documents

## NEW SNARF ( Jing'an) Specification for Dry etching Patterned Sapphire Substrate (DPSS) Meeting Minutes

### 东晶博蓝特刘建哲总

- 对图形形貌的定义（三角锥、圆形）三角锥形偏多；
- 缺陷是4寸还是6寸？
- 按照单位面积小于多少颗后续来写该规格标准？
- 微米尺寸，干法PSS，做这样的标准是否会比较复杂？
- 今后图形化蓝宝石工作组可以做纳米的、湿法、干法、量测方法的标准。

### 福建晶安斯芳虎经理考虑：

- 2寸和4寸，缺陷的大小、面积需要考虑进去，2和4寸不是按照倍数的一个关系；
- 4英寸要求比2寸严格。如果定义颗数，一定要分2、4、6寸。
- SNARF题目缩小范围，再更新一下，同意刘建哲总关于缩小题目范围的建议。

# Progress on the Documents

## **NEW SNARF ( Jing'an) Specification for Dry etching Patterned Sapphire Substrate (DPSS) Meeting Minutes**

### **武良文博士：**

- 新提案，对Nano PSS会做定义吗？
- 福建晶安斯芳虎经理答复：纳米没有考虑进去。

### **哈尔滨工业大学甘阳教授：**

- 对新提案进行了英文用词上的修改

### **SEMI China Sophia：**

- PSS Table 由SEMI China HB-LED NA Committee 下属PSS工作组完成，用于撰写PSS相关标准撰写前的素材收集，该工作组的负责人是Rubicon的John Ciraldo ；
- 会将规范类标准和测试方法类标准撰写的模板发给组内成员 。

## TF Work Plan for the Next Step

Content	When
<b>NEW DRAFT : Specification for Dry etching Patterned Sapphire Substrate (DPSS)</b>	<b>Sep/20/2017</b>
<b>NEW SNARF:Test Method Standard for The Uniformity of Patterns on Dry etching Patterned Sapphire Substrate (DPSS)</b>	<b>Sep/20/2017</b>



# THANK YOU